



(China)

Toppan Photomask enters into partnership with EV Group – September 20, 2022

首页 » 合作 » Toppan Photomask与EV Group达成合作

Toppan Photomask与EV Group达成合作

全球TMT • 1个月前 (09-20) 134浏览

(全球TMT2022年9月20日讯) 光掩模供应商Toppan Photomask Co. Ltd.与为MEMS、纳米技术和半导体市场提供晶圆键合及光刻设备的供应商EV Group (简称EVG) 宣布, **两家公司已达成协议**, 共同推广赋能光电产业的大批量制造(HVM)工艺——纳米压印光刻技术(NIL)。此次合作旨在**确立NIL**为光电制造的行业标准生产工艺, 并加速其在HVM中实施, 以支持各种应用。这些应用包括增强/混合/虚拟现实耳机、智能手机、汽车传感器和医疗成像系统。



TOPPAN
TOPPAN PHOTOMASK

EV

Group和Toppan Photomask

作为此次非排他性合作的一部分, EVG和Toppan Photomask将结合各自的知识、专长和服务, 利用Toppan Photomask提供的主模板和EVG提供的设备及工艺开发服务, 提供**NIL开发工具包**, 以进一步推广NIL技术并提高将该技术应用于工业生产的可能性。EVG还将在其位于奥地利总部的EVG NILPhotonics®能力中心, 面向感兴趣的公司提供NIL技术和产品演示。此外, 对于有意在生产过程中使用NIL技术的企业, 两家公司都将对方指定为首选推荐的供应链合作伙伴。

<http://www.tmtnews.tech/archives/28311>